

耐等离子体材料

京瓷耐等离子体材料有利于提升下一代蚀刻技术

新一代蚀刻技术需要更加强健可靠的材料，以解决等离子体腐蚀、微粒产生、金属污染和氧分解等问题。京瓷提供的耐等离子体材料是新一代蚀刻技术的理想选择

特点

- 耐等离子体
- 介电损耗低

氧化钇

氧化钇具有卓越的抗等离子体腐蚀特性，对于力求降低颗粒污染的半导体加工设备应用而言是理想之选，因为它能降低设备零件更换频次，提高生产效率。



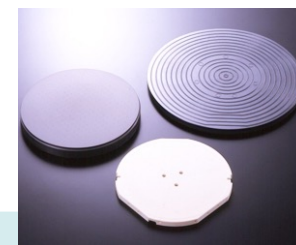
真空吸盘、一体化底盘反射镜、承载台

可根据使用条件进行各种表面加工的高精度真空吸盘

精密陶瓷真空吸盘经过高精度和复杂的表面加工，可处理晶圆夹持、搬运等各种工序

特点

- 高刚性
- 低热膨胀系数
- 高精度



产品参数

产品参数	
材料	氧化铝、碳化硅、堇青石、微孔材料
形状	可提供复杂的表面形状
尺寸	使用于 $\phi 200/300\text{mm}$ 设备
精密	镜面精度： $\lambda/20$ 及以下 反射率：95%及以上
特殊工艺	PVD、CVD、镜面图层、接合技术